石墨烯在强激光作用下改性的拉曼研究*

张秋慧^{1)2)†} 韩敬华²⁾ 冯国英²⁾ 徐其兴¹⁾ 丁立中¹⁾ 卢晓翔³⁾

1)(河南工程学院电气信息工程系,郑州 451191)

2)(四川大学电子信息学院,成都 610064)

3)(休斯顿大学电子计算机学院,休斯顿)

(2012年3月2日收到; 2012年4月17日收到修改稿)

采用化学气相沉积法制备了不同层数的石墨烯样品.根据石墨烯透过率曲线分析石墨烯样品层数与 550 nm 处透过率关系的同时,利用拉曼光谱法分析了不同层数石墨烯样品在强激光辐照下的损伤特性.结果表明:单层石墨 烯样品经强激光辐照后,G 带和 2D 带均向高频移动;多层石墨烯样品经强激光辐照后只有G 带发生了略微的频移;石墨烯样品拉曼光谱G带与2D 带强度比值表征了石墨烯的层数,此比值随激光辐照时间的增加而减小,这表明强激光对石墨烯样品具有明显的剥离现象.

关键词: 石墨烯, 拉曼光谱, 改性

PACS: 42.25.BS, 81.05.ue, 78.30.Ly

1引言

石墨烯 (graphene) 是由单层碳原子紧密堆积成 的二维蜂窝状晶格结构的碳质材料.目前制备石墨 烯的方法多种多样,例如化学气相沉积、机械剥离 石墨等^[1,2]. 虽然石墨烯只有一个碳原子厚度, 并 目是已知材料中最薄的一种,但是其强度比钻石还 要硬 ^[3]. 石墨烯电阻率仅约 $10^{-6} \Omega/m$, 比铜和银 更低,是目前电阻率最小的材料,电阻率低,电子运 动速度就快,所以石墨烯是目前已知材料中导电性 能最出色的材料^[4].石墨烯还具有较高的杨氏模 量 (~ 1100 GPa)、热导率 (~ 5000 W·m⁻¹·K⁻¹)、 较高的载流子迁移率 (2 × 10⁵ cm²·V⁻¹·s⁻¹)、巨 大的比表面积 (理论计算 2630 m²·g⁻¹)、铁磁性 等^[5-8] 优良特性. 优异的电学、光学特性使其有 望取代硅基电子器件成为新一代的优良半导体而 广泛应用于低能耗、高电子迁移率的纳米光电子 器件中.随着激光技术和电子科学技术的发展,激 光在光电子器件中所起的作用越来越重要.所以石

墨烯材料在激光作用下的物理化学、机械稳定性 研究对石墨烯光电子器件的开发和发展至关重要, 同时激光作用下石墨烯材料的缺陷特性研究对于 理解和预估石墨烯材料的某些特性起着决定性的 作用.激光辐照效应产生的缺陷可能导致电子迁移 率和热传导特性的劣化.石墨烯仅含有单层或基层 碳原子层,故即使在低功率激光的辐照下也有可能 产生严重的破坏.尽管对激光辐照下石墨烯特性变 化的研究至关重要,但是至今未见报道.改变碳材 料特性的一个方法是电子束辐照产生缺陷^[9],而且 大量研究者研究了电子束对石墨的影响^[10,11],但 至今尚未见关于单层或多层石墨烯在激光辐照下 的资料.

本文采用化学气相沉积法制备了单层和多层 石墨烯样品,并机械地转在不同的基底上.测量了 石墨烯材料 550 nm 处透过率与层数的关系,同时 给出了强激光辐照下单层石墨烯和多层石墨烯拉 曼光谱的变化和损伤形貌.激光辐照的热作用使石 墨烯 G 带和 2D 带均向高频移动,拉曼光谱是研究 晶体结构微小变化的有效手段之一,并且在其他碳

^{*}国家自然科学基金(批准号:60890203)资助的课题.

[†] E-mail: newyear1234@163.com

^{© 2012} 中国物理学会 Chinese Physical Society

材料的辐照损伤方面应用很广泛[12,13].

2 样品制备

本文使用的石墨烯样本均采用化学气相沉积 法 (CVD) 生长在铜片上, 然后机械地转在盖玻片或 镀有二氧化硅薄膜的硅基底上.图1给出了1—4 层石墨烯照片, 基底为盖玻片.从图1可以看出, 随 着层数的增加样品颜色依次变暗, 这也就意味着随 着层数的增加石墨烯样品在可见光波段透过率依 次减小. 故我们测量了这四个样品的透过率, 如图2 所示.



图 1 不同层数的石墨烯照片 左上,单层石墨烯;右上, 两层石墨烯;左下,三层石墨烯;右下,四层石墨烯



图 2 不同层数石墨烯透过率曲线

图 2 给出了不同层数石墨烯样品的透过率曲线. 从图中可以看到随着层数的增加, 石墨烯透过率依次下降. 为了对比我们制得的石墨烯样品的透过率与理论计算得到的透过率的差别, 给出了理论和实验得到的石墨烯在 550 nm 的透过率层数的关

系曲线,如图 3 所示. 同理论计算一样,单层石墨烯 样品在 550 nm 处的透过率约为 97.7%,这与石墨烯 精细晶格常数 α 有关^[14],其中 πα = 2.3%. 这就意 味着单原子层厚的石墨烯样品将吸收 2.3%的入射 光.理论结果同样表明石墨烯透过率随着层数的增 加而减小,每增加一层石墨烯,透过率将减小 2.3%, 我们的实验结果和理论结果是一致的.



图 3 石墨烯材料 550 nm 透过率与层数的理论和实验关系曲线

3 石墨烯在高强度激光辐照下的损伤

如图 4 所示, 532 nm 连续激光经全反镜 R1, R2 反射后, 经分光镜 M1, M2 分光后进入显微镜头, 显微镜头将入射激光聚焦在样品表面, 同时显微 镜头收集样品表面散射光, 收集的散射光经分光 镜 M2, 全反镜 R3, 532 nm 滤光片 F1 后射入光谱 仪. 532 nm 滤光片滤掉了本身的激发光, 排除了激 发光对散射信号的影响. 图 4 中的 CCD 用于观测 样品是否聚焦在显微镜头的焦点处. 此装置既为石



图 4 石墨烯损伤实验装置 R1, R2, R3 为全反镜; M1, M2 为分光镜; F1 为 532 nm 滤光片

墨烯损伤实验装置,又可以测量石墨烯的拉曼光谱, 这就保证了损伤点和拉曼测试点为同一点,测量结 果更加准确.

激光辐照之前,测量了石墨烯样品的拉曼光谱, 从而表征石墨烯样品层数以及对比损伤前后拉曼 光谱的变化.单层和多层石墨烯样品采用 CVD 沉 积在铜片上,沉积在铜片上的石墨烯样品被机械地 转在镀有二氧化硅薄膜的硅片上,将转在硅片上的 石墨烯样品分别放置在图 4 所示的样品台上,经激 光辐照一段时间后立即测量其拉曼光谱.激光辐照 功率分别采用 1.68 和 1 W,聚焦镜头为 50 倍显微 镜头.测量拉曼光谱时在光路中加入中性滤光片, 使入射激光强度降到足够小,从而减小激发光对拉 曼信号的影响,排除激发光引起的材料改性.拉曼 实验结果如图5和图6所示.

对于单层石墨烯样品来说,随着入射激光照射时间的增加,G带和2D带均向高频移动,并且强度下降,G带从1587 cm⁻¹移向1601 cm⁻¹,2D带从2684 cm⁻¹移向2692 cm⁻¹,G/2D强度比值也从0.68减小到0.42.对于多层石墨烯样品,随着入射激光的照射,G带和2D带强度下降,G带轻微向高频移动,从1587 cm⁻¹移向1590 cm⁻¹,2D带未见明显的频移,G/2D强度比值也从2.37 减小到1.53.



图 5 (a) 单层石墨烯材料在激光辐照前后的拉曼光谱, 激光辐照功率为 1.68 W; 激光辐照前, G 带中心波数为 1587.3 cm⁻¹, G/2D = 0.69; 激光辐照 5 min 后, G 带中心波数为 1601.3 cm⁻¹, G/2D = 0.49; 激光辐照 10 min 后, G 带中心波数为 1601.3 cm⁻¹, G/2D = 0.49; 激光辐照 10 min 后, G 带中心波数为 1601.3 cm⁻¹, G/2D = 0.42; (b) 局部放大图



图 6 (a) 多层石墨烯材料在激光辐照前后的拉曼光谱, 激光辐照功率为 1 W; 激光辐照前, G 带中心波数为 1587.3 cm⁻¹, G/2D = 2.37; 激光辐照 10 min 后, G 带中心波数为 1590.3 cm⁻¹, G/2D = 1.78; 激光辐照 20 min 后, G 带中心波数 为 1590.3 cm⁻¹, G/2D = 1.59; 激光辐照 30 min 后, G 带中心波数为 1590.3 cm⁻¹, G/2D = 1.53; (b) 局部放大图

D 峰和 G 峰的排列直接表征了碳材料的分子图谱. 1350 cm⁻¹ 拉曼峰为石墨烯的 D 峰, 此峰 表征了石墨烯样品中的缺陷, 同时也表征了石墨 烯的底面化学反应,此底面化学反应包括 π 键断 裂和 sp² 碳原子转变成 sp³ 碳原子 ^[15]. D 带位 于 1355 cm⁻¹ 附近,是由 K 区边界附近声子呼吸 振动模式 A_{1g} 振动引起的^[16], D 带是离散的,随着 激发光子能量的变化而变化,在完美石墨烯样品中 是观察不到这个振动峰的,只有当样品中出现缺陷 时此峰才被激活. 从图 5 所示结果可以看出本文的 石墨烯样品有清晰的 D 峰,这说明本文的石墨烯样 品在生长过程中引入了很多缺陷.随着激光照射时 间的增加, D 带强度减小,这说明激光的退火作用 可以减小石墨烯样品中缺陷的数量.

*G*峰为长波长光频声子,由所有成对的 sp² 碳原子在环和链中的拉伸引起的 *E*_{2g} 模 ^[17].石 墨烯 *G*峰的位置和线宽敏感于长波狄拉克费米 子激发耦合,这就说明费米能级将向着远离中 性点的方向移动 ^[15,17].初始石墨烯样品 *G*峰位 于 1587 cm⁻¹,随着激光辐照时间增加,*G*峰能量上 移到 1601 cm⁻¹,这意味着激光的退火作用使石墨 烯费米能级向远离中性点方向移动.但是此频移低 于石墨烯缺陷掺杂引起的频移 ^[15].

石墨烯 2D 拉曼峰是石墨烯布里渊区 K 点附 近最高光频支中两个相反动量的光子产生的. 2D 拉曼峰频率是散射光子频率的两倍,其形状、线宽 和位置直接反映了石墨烯电子带结构,而这些电子 带结构又同石墨烯原子层数有关.这主要是由于双 共振导致石墨烯层与层之间的堆叠产生的电子带 分裂,而 2D 带恰恰反映了电子带的分裂^[18].经激 光辐照后,石墨烯 2D 拉曼峰频移仅几个波数,这说 明 2D 拉曼峰对外界强激光的辐照反应并不是很明 显. G 峰与 2D 峰强度比表征了石墨烯样品的碳原 子层数,初始 G/2D 强度比为 0.49,高强度 532 nm 激光辐照 10 min 后,此比值减小,这说明高强度激 光的热作用使石墨烯材料熔化剥离,即高强度激光 的烧蚀作用减小了石墨烯材料的厚度.

图 7 给出了石墨烯材料在高强度 532 nm 连 续激光作用下的损伤形貌. 石墨烯出现明显的激 光辐照损伤痕迹, 但没有明显的断裂痕迹, 从损 伤局部图可以看出石墨烯损伤形貌成波纹状. 石 墨烯样品吸收入射激光能量, 当吸收的热量达到 石墨烯熔点时, 石墨烯样品发生熔融, 熔融的石墨 烯样品在激光辐照的冲击下发生流动, 激光辐照 一旦停止, 熔融石墨烯样品固化, 留下波纹状损伤 形貌.





图 7 石墨烯损伤形貌 (a) 整体; (b) 局部

4 结 论

石墨烯材料作为新型光电材料具有其他材料 无法比拟的光电特性.单层石墨烯样品为几乎光学 透明的半金属膜,随着层数的增加,透过率成比例 下降.石墨烯材料经激光辐照后吸收入射激光能量 熔融,熔融的石墨烯材料在入射激光的冲击下发生 流动,激光辐照停止后固化成波纹状损伤形貌.激 光的热作用使石墨烯样品退火,激光辐照单层石墨 烯样品后,G带和2D带均向高频移动,而多层石 墨烯样品经激光辐照后只有G带发生了略微的频 移.拉曼实验结果表明强激光对石墨烯样品具有明 显的剥离作用.这些研究结果将有助于理解和预估 石墨烯材料的某些特性,对新型石墨烯光电子器件 的设计和开发具有指导意义.材料特性直接决定材 料的使用,石墨烯优异的光学、电学特性使其有望 被用于发展更薄的光电子器件、透明触摸屏、太 阳能电池、新型激光器等等.在现有研究的基础上, 我们将进一步加强石墨烯光饱和吸收特性以及缺 陷掺杂对石墨烯光电特性的影响,力求进一步改善和提高石墨烯的光电特性.

- Novoselov S K, Geim A K, Morozov S V, Jiang D, Zhang Y, Doubonos S V, Grigorieva I V, Firsov A A 2004 Science 306 666
- [2] Campos-Delgado J, Kim Y A, Hayashi T, Morelos-Gomez A, Hofmann M, Endo M, Terrones H, Shull R D, Dresselhaus M S, Terrones M 2009 *Chem. Phys. Lett.* 469 177
- [3] Jiao L Y, Zhang L, Wang X R, Diankov G, Dai H 2009 Nature 458 877
- [4] Castro Neto A, Guinea F, Peres N, Novoselov K, Geim A 2009 Rev. Mod. Phys. 81 109
- [5] Bolotin K, Sikes K J, Jiang Z, Klima M, Fudenderg G, Hone J, Kim P, Stormer H L 2008 Solid State Commu. 146 351
- [6] Balandin A A, Ghosh S, Bao W Z, Calizo I, Teweldebrhan D, Miao F, Lau C N 2008 *Nano Lett.* 8 902
- [7] Geim A K, Novoselov K S 2007 Nat. Mater. 6 183
- [8] Li X S, Cai W W, An J B, Kim S, Nah J, Yang D X, Piner R, Velamakanni A, Jung I, Tutuc E, Banerjee S K, Colombo L, Ruoff R S 2009 Science 324 1312

- [9] Takeuchi M, Muto S, Tanabe T, Arai S, Kuroyanagi T 1997 Phil. Mag. A: Phys. Conden. Matter Struct. Defects Mech. Properties 76 691
- [10] Niwase K 2002 Phil. Mag. Lett. 82 401
- [11] Zaiser M, Banhart F 1997 Phys. Rev. Lett. 79 3680
- [12] Brunetto R, Baratta G, Strazzulla G 2004 J. Appl. Phys. 96 380
- [13] Compagnini G, Baratta G 1992 Appl. Phys. Lett. 61 1796
- [14] Nair R R, Blake P, Grigorenko A N, Novoselov K S, Booth T J, Stauber T, Peres N M R, Geim A K 2008 Science 320 1308
- [15] Jung N, Kim N, Jockusch S, Turro N J, Kim P, Brus L 2009 Nano Lett. 9 4133
- [16] Ferrari A, Robertson J 2000 Phys. Rev. B 61 14095
- [17] Yan J, Zhang Y, Kim P, Pinczuk A 2007 Phys. Rev. Lett. 98 166802
- [18] Hulman M, Haluška M, Scalia G, Obergfell D, Roth S 2008 Nano Lett. 8 3594

Raman spectrum research on graphene modification under high intensity laser*

1) (Department of Electrical Information Engineering, Henan Institute of Engineering, Zhengzhou 451191, China)

2) (College of Electronics and Information Engineering, Sichuan University, Chengdu 610064, China)

3) (Electrical and Computer Engineering, University of Houston, USA)

(Received 2 March 2012; revised manuscript received 17 April 2012)

Abstract

The graphene samples with different numbers of layers are prepared by chemical vapor deposition, the relation between the number of graphene layers and the transmission at 550 nm is analyzed by graphene transmission spectrum. Besides, the damage characteristics of graphene under high intensity laser irradiation are analyzed. The results show that under the laser irradiation, for the single layer graphene, G band and 2D band shift toward high frequency but for the multilayer graphene, only G band shifts a litile; the ratio between intensities of G band and 2D band in Raman spectrum characterizes the number of graphene layers, and it increases with the irradiated time, so the high intensity laser can peel the graphene.

Keywords: graphene, Raman spectrum, modification **PACS:** 42.25.BS, 81.05.ue, 78.30.Ly

^{*} Project supported by National Natural Science Foundation of China (Grant No. 60890203).

[†] E-mail: newyear1234@163.com